



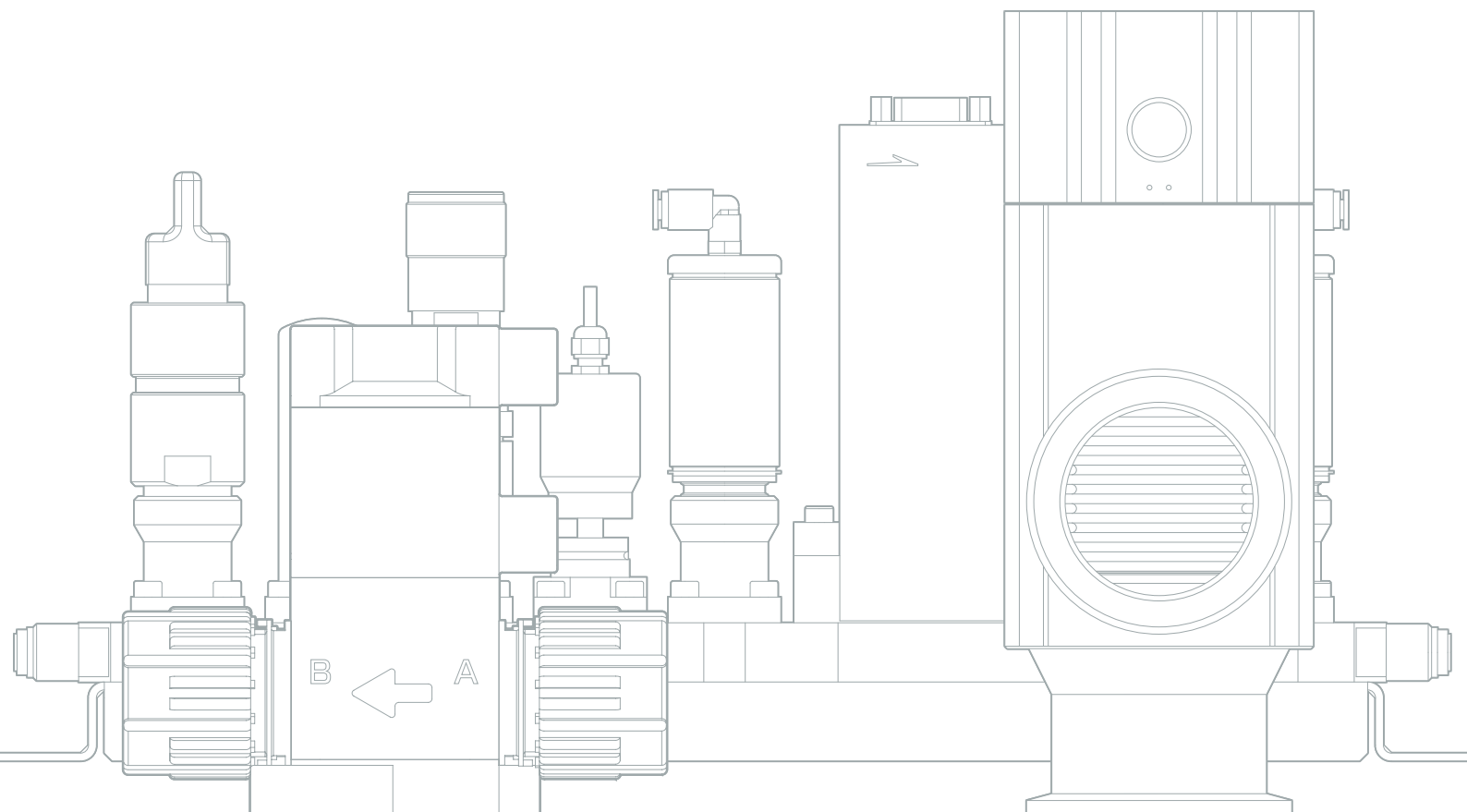
Fine System Components

For Semiconductor, LED, FPD
Manufacturing Processes

Ultra High Purity



For Manufacturing Improvements

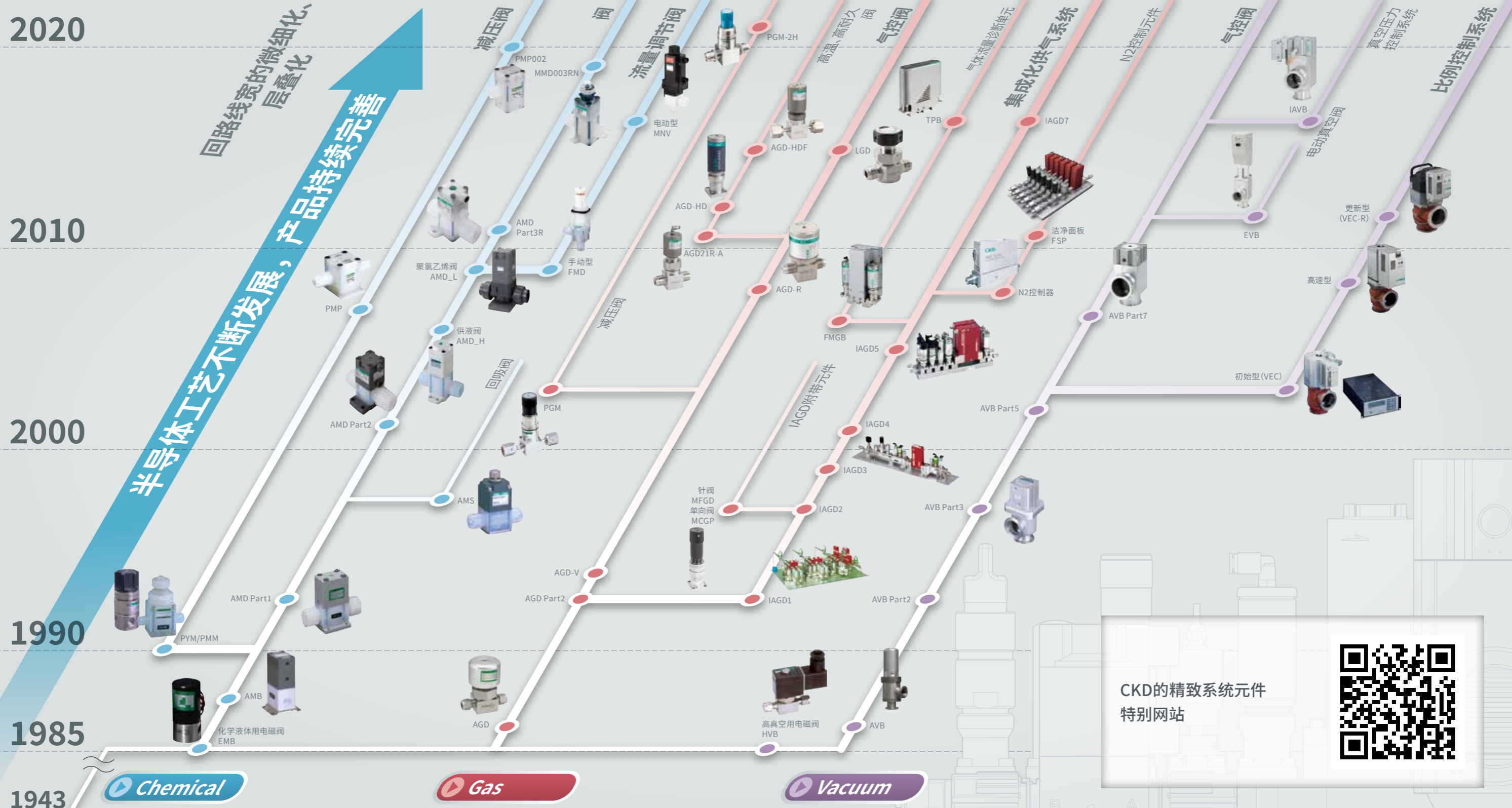
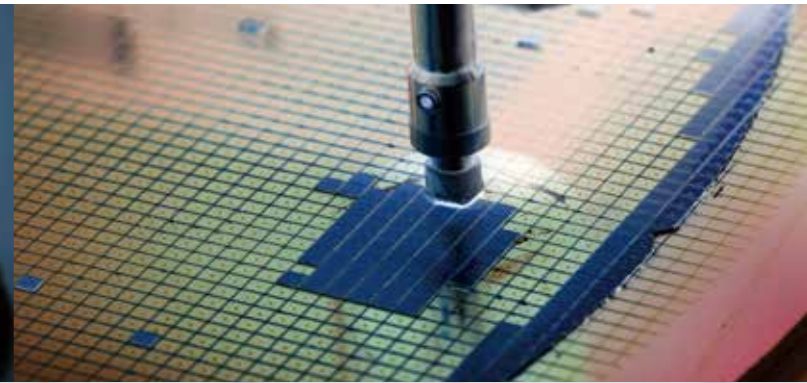


CKD Corporation

CC-1394CS **1**

精致系统元件的升级

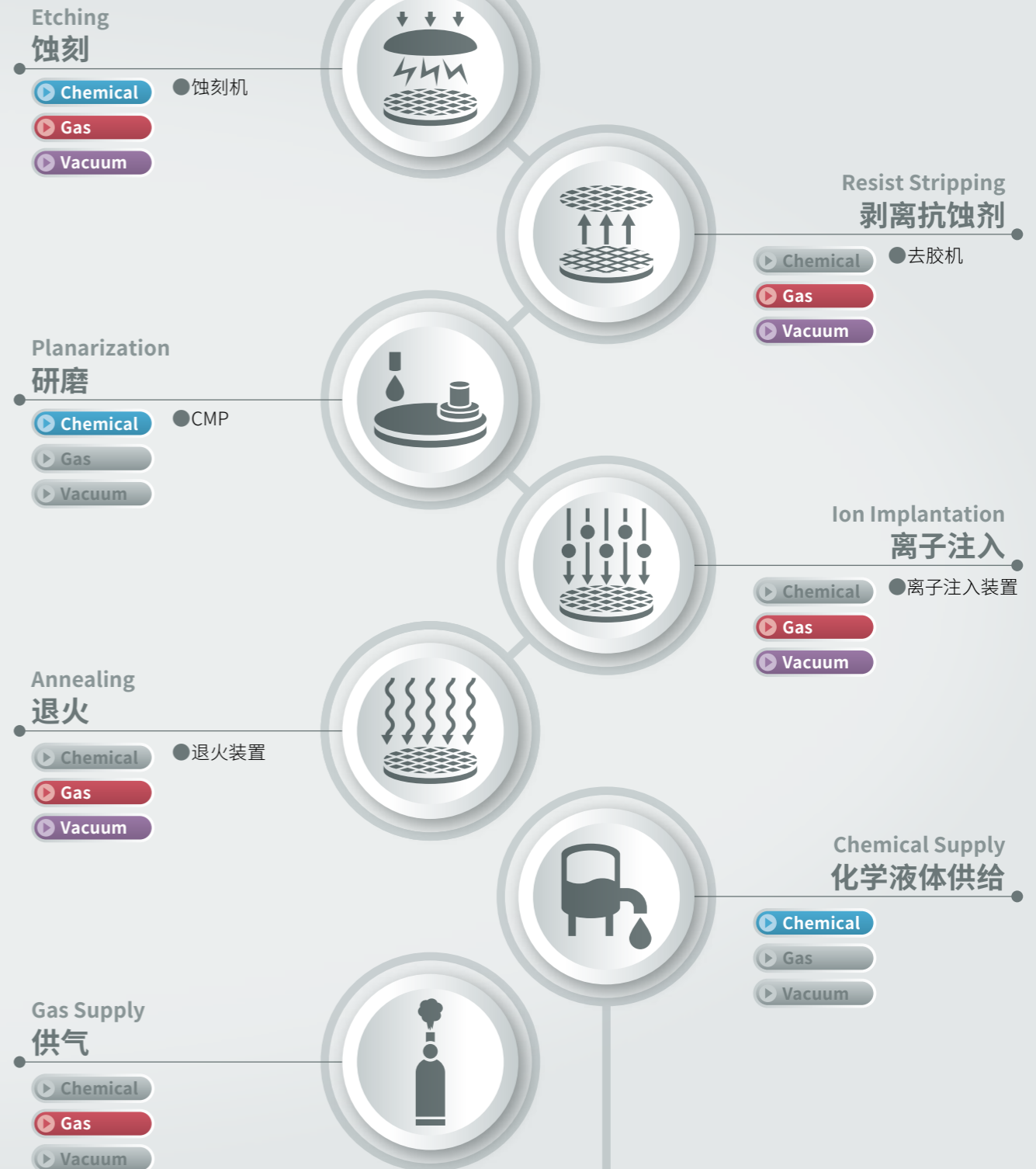
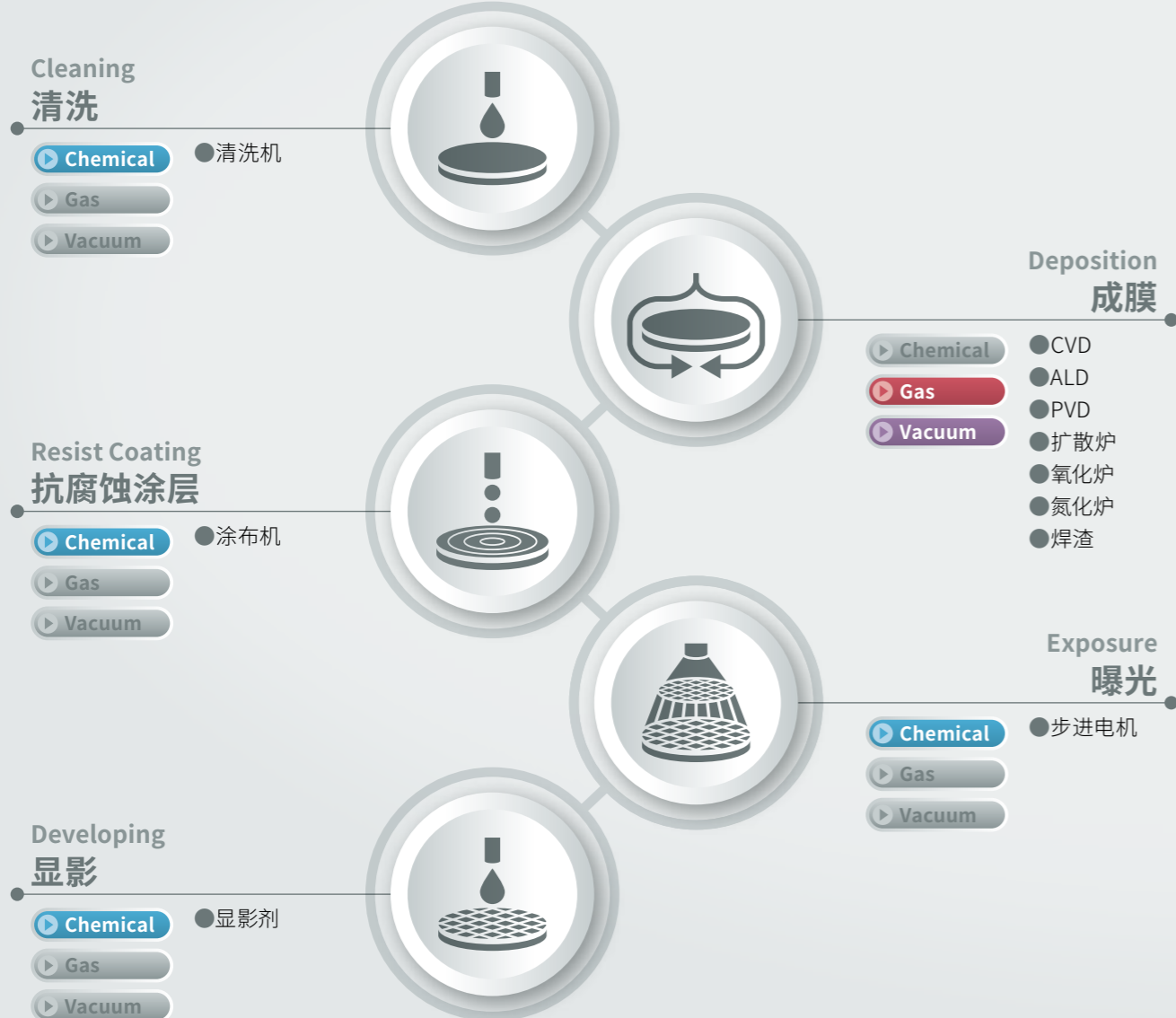
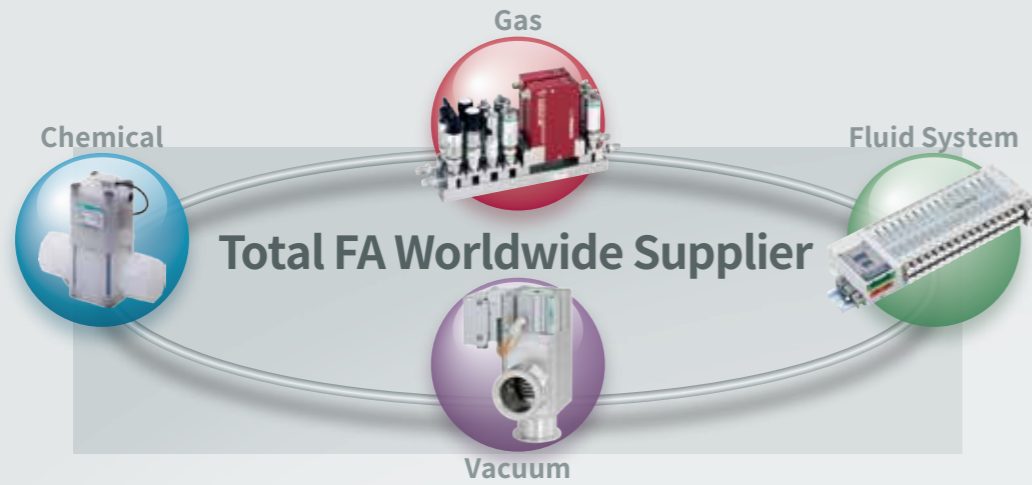
以“自1980年起积累的技术实力”、“核心部件的一条龙生产”、“完备的制造工序管理”，
 长期实现半导体制造工序的高精度化、质量稳定和高纯度。
 今后将继续为客户提供“便于使用”的产品。



CKD的精致系统元件
特别网站

作为半导体制造工艺的总供应商

从半导体元件制造设备至生产工艺装置，
提供化学液体、工艺气体、真空、气动控制的综合解决方案。
为客户提供“更易选择”的产品。



精致系统元件产品系列

Chemical Chemical Process

实现对化学液体、纯水、研磨液超洁净控制的高纯化学液体系统。

阀

气控阀 AMD※※3R 标准型化学液体用气控阀。 广泛支持压力、温度及流体条件的高端产品。 可将以往分开使用的机种集成为一体。	气控阀(无金属) AMD※1M 彻底排除金属部件，适用于浸蚀性、渗透性强酸(盐酸、氢氟酸)管路。 实现工厂下层设施的安全化学液体供给。	气控阀(高压用) AMD※1H 为了使大流量的化学液体流动，可承受高压和高背压的阀。 实现工厂下层设施的安全化学液体供给。
气控阀(集成阀) GAMD※※3R AMD※※3R集成化，节省空间，减少配管元件类。 可定制形状和通路，可用于化学液体的分支及混合等。	化学液体用手动阀 MMD※03RN 标准型化学液体用手动阀。 通过对应高压、高温，实现了工艺的高度化。 防止误动作、误操作，减少泄漏风险。	手动阀(无金属) MMD※0M 彻底排除金属部件，适用于浸蚀性、渗透性强酸(盐酸、氢氟酸)管路。 实现工厂下层设施的安全化学液体供给。 防止误动作、误操作，减少风险。
手动阀(高压用) MMD※0H 为了使大流量的化学液体流动，可承受高压和高背压的阀。 实现工厂下层设施的安全化学液体供给。 防止误动作、误操作，减少风险。	化学液体用手动阀(集成阀) GMMD※※3RN MMD※3RN集成化，节省空间，减少配管元件类。 可在确保化学液体采样线等安全性的同时可靠地操作。	

减压阀

先导式减压阀 PMP 省空间型 追加PMP002系列。 与电空减压阀组合，还可进行远程操作。	手动式减压阀 PYM・PMM 用于控制纯水等的压力的手动式减压阀。
--	---

流量调节阀

手动流量调节阀 FMD 手动式流量调节阀(针阀)。 接触液体部位使用氟树脂，即使是腐蚀性较高的流体(盐酸、氢氟酸)等也可使用。 实现精密的流量调整。	电动流量调节阀 MNV 电动式流量调节阀(针阀)。 可通过远程操作变更设定流量。	手动微小流量调节阀 LYX 可调节微小流量的手动式流量调节阀(针阀)。
--	---	---

其他

回吸阀 AMS 通过抑制化学液体喷出的混乱和滴落，实现绝缘涂料均匀涂布。 可根据流体粘度，进行优化订制设计。	气控阀・回吸阀一体型 AMDS 通过抑制化学液体喷出的混乱和滴落，实现绝缘涂料均匀涂布。 可根据流体粘度，进行优化订制设计。 气控阀一体型，可缩短配管工时，外形更小巧。	精致液位开关 KML 高精度检测纯水、酸、碱、溶剂等多种流体的液位，输出电气信号。 采用耐化学液体环境、异物等环境的气动方式。
---	--	--

Gas Gas Process

有助于对气体和不活性气体进行超精密控制的工艺气体控制系统。

气控阀 AGD(高温、高耐久) 可满足随着细微化发展而需要高耐久性的工艺气体用阀。 满足客户需求，新增3种规格。	气控阀・手动阀 LGD 工艺气体用阀的新品种。	减压阀 PGM 采用金属膜片的工艺气体用减压阀。 可以稳定气体压力和流量。
气控阀 AGD 工艺气体用阀的基础产品。 除了单体、集成型外，还备有3通阀、2连3通阀等种类丰富的产品。	手动阀 OGD 采用90°旋转突跳方式的手动阀。	手动阀 MGD 手动式阀。 采用270°旋转方式的手柄开闭型。
系统 集成化供气系统 IAGD 维护性得到提高的省空间工艺气体供给系统。 可根据客户要求流程进行设计和制作。	洁净单元 FICS CKD承诺可以按照客户的需求和流程，进行设计、制造及检验。	系统功能产品 工艺气体流量诊断单元 TPB 高精度、短时间监控工艺气体流量。 通过2~60秒以内/Line短时间测定，实现异常的早期发现。 为装置工作进程的稳定性作出贡献。
		真空发生器 VG 节能型真空排气装置。工艺气体排气用真空发生器。 喷嘴直径：φ0.5。

Vacuum Vacuum Process

可提高腔室等的排气和压力控制精度的高真空控制元件。

气控阀 AVB 采用CKD自研的成型波纹管的特殊结构，实现了长寿命、高耐久性。 兼具高可靠性和易用性的高真空阀。	手动阀 MVB 手柄旋转式高真空用手动阀。 铝阀体型、不锈钢阀体型。	压力控制系统 IABV 除了具备原有高真空阀的可靠性，还可实现多种工艺的压力控制。	比例控制系统 VEC-R 实现高精度高真空比例控制的APC系统。 外形更紧凑、重量更轻。
---	---	---	---

Fluid System Auxiliary Components

供给空气、冷却水高精度控制系统，有助于半导体制造。

流量传感器 流体用流量传感器 WFK2 荣获2018年度日本Good Design奖。 涵盖0.4~250L/min的卡曼涡街式流量传感器。 活跃在冷却水的流量和温度管理。	水控制集成单元 WXU 集成冷却水循环回路的流量传感器和阀。 大幅减少配管作业工时，占用空间减少80%，实现了省空间。	气体用流量传感器RAPIFLOW® FSM3 1台即可对应空气、氮气、氩气、二氧化碳、混合气体等5种气体的流量传感器。 在半导体相关再生用途中，备有洁净规格、不锈钢阀规格、带流量调节的规格。
阀 先导式3・4通电磁阀 MN3E・MN4E 实现业内优异的阀模块宽度(7mm)・小型化(高39.5mm)。 高性能3・4通模块集成。 气控阀的驱动用途。	直动式3通电磁阀 3QRA/B 实现大流量、高速切换，有助于实现装置的高速化、优化。 实现业内优秀的高耐久(1亿次)和轻量(19g)。 适用于高温、高耐久气控阀的高速驱动用途。	减压阀 PARECT电空减压阀 EVS2 实现30mm宽的小型、轻量、高性能电空减压阀。 可对化学液体用先导减压阀(PMP系列)进行远程控制。

Production & Technology Network

~For Fine System Components~



本样本中的产品及其相关技术和软件，受日本《外汇及对外贸易法》的补充性出口条例管控。
需从日本出口本产品及其相关技术或软件时，根据日本法律请务必注意防止将其用于与军火、武器相关的用途中。
The goods and/or their replicas, the technology and/or software found in this catalog are subject to complementary export regulations by Foreign Exchange and Foreign Trade Law of Japan.
If the goods and/or their replicas, the technology and/or software found in this catalog are to be exported from Japan, Japanese laws require that the exporter makes sure that they will never be used for the development and/or manufacture of weapons for mass destruction.

喜开理(上海)机器有限公司 营业本部 上海市徐汇区虹梅路1905号远中科研大楼6楼601 200233
电话 (021) 61911888 传真 (021) 60905357

<Website>
<https://www.ckd.sh.cn/>

●出于改良的目的，本样本上记载的产品规格及外观可能会进行变更，恕不另行通知，敬请谅解。
©CKD Corporation 2025 All copy rights reserved.
©喜开理(上海)机器有限公司 2025版权所有



官方公众号



官方视频号